

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年10月5日(05.10.2023)



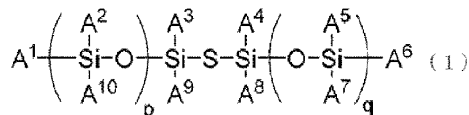
(10) 国際公開番号

WO 2023/190386 A1

- (51) 国際特許分類:
C07F 7/08 (2006.01) C23C 16/455 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01) H01L 21/316 (2006.01)
C23C 16/42 (2006.01) H01L 21/318 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/012290
- (22) 国際出願日: 2023年3月27日(27.03.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-054385 2022年3月29日(29.03.2022) JP
- (71) 出願人: 住友精化株式会社(SUMITOMO SEIKA
CHEMICALS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6750145 兵
庫 県 加 古 郡 播 磨 町 宮 西 3 4 6 番 地
の 1 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: 平 元輝(TAIRA, Genki); 〒6750145 兵
庫 県 加 古 郡 播 磨 町 宮 西 3 4 6 番 地 の 1 住
友 精 化 株 式 会 社 内 Hyogo (JP). 上 野 恵 英
(UENO, Yoshihide); 〒6750145 兵 庫 県 加 古 郡 播
磨 町 宮 西 3 4 6 番 地 の 1 住 友 精 化 株 式 会 社
内 Hyogo (JP). 島 田 新 大(SHIMADA, Hajime);
〒6750145 兵 庫 県 加 古 郡 播 磨 町 宮 西 3 4 6 番 地
の 1 住 友 精 化 株 式 会 社 内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 山尾 憲人, 外(YAMAO, Norihito et al.);
〒5300017 大 阪 府 大 阪 市 北 区 角 田 町 8 番
1 号 大 阪 梅 田 ツ イン タ ワ ー ズ ・ ノ ー ス
青 山 特 許 事 務 所 Osaka (JP).

(54) Title: SULFUR-CONTAINING SILOXANE, COMPOSITION FOR FORMING SILICON-CONTAINING FILM COMPRISING SAID SULFUR-CONTAINING SILOXANE, SULFUR-CONTAINING SILOXANE PRODUCTION METHOD, SILICON-CONTAINING FILM, AND SILICON-CONTAINING FILM PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: 硫黄含有シロキサン、前記硫黄含有シロキサンを含むシリコン含有膜形成用の組成物、硫黄含有シロキサンの製造方法、シリコン含有膜、及びシリコン含有膜の製造方法



(57) Abstract: The present invention provides a sulfur-containing siloxane represented by formula (1) [in formula (1): A^{1-10} , in each appearance, are each independently a hydrogen atom, an organic group, a halogen, a siloxy group represented by $\text{OSi-R}^a\text{R}^b\text{R}^c$, or an amino group represented by NR^dR^e , provided A^1 and A^3 may be a single oxygen atom and may form a cyclic siloxane, and A^4 and A^6 may be a single oxygen atom and may form a cyclic siloxane; R^{a-e} , in each appearance, are each independently a hydrogen atom or organic group, and R^d and R^e may bind to each other to form a ring; and p and q are each independently an integer 1-5].

(57) 要約: 本発明は、下式(1) [式(1)中、 A^{1-10} は各出現においてそれぞれ独立して水素原子、有機基、ハロゲン、 $\text{OSi-R}^a\text{R}^b\text{R}^c$ で表されるシロキシ基、又は NR^dR^e で表されるアミノ基であり、ただし、 A^1 と A^3 は一体として酸素原子であって環状シロキサンを形成してもよく、 A^4 と A^6 は一体として酸素原子であって環状シロキサンを形成してもよく; R^{a-e} は各出現においてそれぞれ独立して水素原子、又は有機基であり、 R^d と R^e は互いに結合して環を形成してもよく; p 及び q はそれぞれ独立して1~5の整数である。]で表される硫黄含有シロキサンを提供する。

[続葉有]

WO 2023/190386 A1

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))